は出手伸之氏)を訴えていた米 ローラル・フェアチャイルド社 ローラル・フェアチャイルド社 の主張を退け、ソニー勝訴の判 決を下した。同訴訟はソニーが 特許を侵害しているとの陪審員 特許を侵害しているとの陪審員 特許を侵害しているとの陪審員 が決を下した。同訴訟はソニーが 特許を侵害しているとの陪審員 が決を下した。同訴訟はソニーが リ、ソニーの勝訴は他社の審理 にも影響も与えそろだ。 ソニーが十五目明らかにした ところによると、ニューヨーク

From Japanese News Paper, July 16, 1996.

1996年7月 日刊工業新聞記事から

(2000年1月米国最髙裁で最終決着ソニー勝訴) In January 2000, the US supreme court made the final judgement favoring Sony claims. And the long SONY-Fairchild Patent War on the PDD with the built-in vertical overflow drain (VOD) ended. では、フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェアチャイルドローラル・フェア・フェーをのびられている。

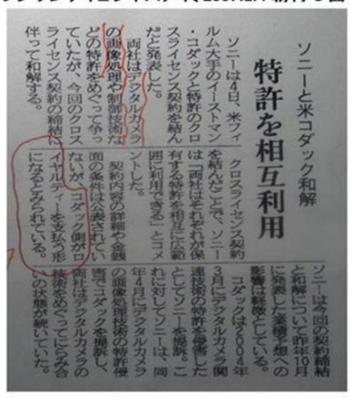
CCDはカメラー体例VTRやファクスなどの数子供例に使われる光学部品で、可学の目に使われる光学部品で、可学の目にと呼ばれる重要部品。フェアチと呼ばれる重要部品。フェアチと呼ばれる重要部品。フェアチ

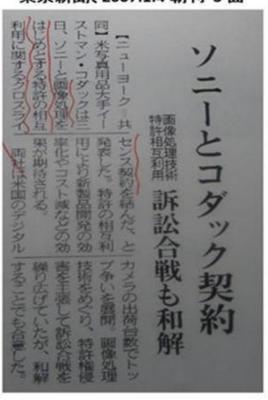
D特許侵害訴訟 野 %

MANN .

NY東部地裁

Sony Chairman Ohga and Hagiwara at Chairman Office in Sony Tokyo Headquarter, 1996





KODAK Sony Patent Agreement on Image Sensor and Digital Camera 2007.1.4

Story of Pinned Photodiode and Sony HAD Sensor Sony Kumamoto Technology Center is the center of Image Sensor World.



Hagiwara explained why Sony is now so strong in the Image Sensor World.

発明公開の公式HPには「NECの寺西氏がPinned Photodiodeである」と記載されているがこれは事実誤認である。 「東芝の山田氏がVODの発明者である」とあるが記載されているがこれも事実誤認である。

概要

撮像デバイスの研究開発は、19世紀後期のテレビション研究がスタートである。機械式、撮像管、固体撮像素子(以下「イメージセンサー」と呼ぶ)と発展し、社会に大きなインパクトを与えつつ、大きく発展してきた。

真空管の一種である場像管は、サイズが大きい、割れ物である、消費電力が大きい、画像にゆがみがある、高価である、などの欠点があり、固体化が望まれていた。1960年代半ばにイメージセンサーの開発がスタートした。そのときは、MOS(Metal Oxide Semiconductor)型が中心であった。

1970年にBoyleとSmith (当時Bell研究所) が C C D (Charge-Coupled Device、電荷結合素子) を発表した』。構造が単純であり、イメージセンサーのような大規模なアレイ構造を製造するのに選していること、矢総ぎ早にC C D に改善が加えられたことから、イメージセンサー開発の中心はC C D になった。1970年後半からは開発の中心は日本に移った。1978年、山田哲生 (当時 東芝) は、強い光が入射したときに縦線の偽信号を発生させるブルーミングを抑制する縦型オーバーフロードレイン構造を発明した②。1979年には寺西信 (当時 N E C) が、白傷や暗電流を大幅に低減し、残像や転送ノイズを解消する埋込フォトダイオード (Pinned Photodiode) を発明した②。これらの結果、C C D はまずムービーを、引き続きコンパクトデシタルスチルカメラを主な市場として重査されていった。

1990年代になると、CMOSの微細化が進み、4個ほどのトランジスターを圓素内に配置することが可能になり、さらには、埋込フォトダイオードをCMOSイメージセンサーに適用することで C C D と同等以上の低ノイズが達成でき、世界の多くの機関で熱心に開発が進められた。2000年に米田智也ら(当時 キヤノン)が、強い光が入射したときに発生するシェーディングを抑制する構造を発明した4。2001年に鈴木亮司ら(当時 ソニー)が、裏面解射型に関する発明をした5。これらの技術開発によりCMOSイメージセンサーが主役に扱い、低消費電力という特性のお油もあり、携帯電話に搭載され、生産量を爆発的に増加させていった。2010年に梅林拓ら(当時 ソニー)が、イメージセンサーに国像処理回路を積高する構造を発明しる。高速化と多模能化を飛躍的に推し進めた。

2014年には携帯電話用を中心に約38億値もの生産が行われた。パソコンカメラ、デジタルスチルカメラ、ゲー Δ などのコンシューマー用途、監視用、車載用、放送用カメラなどの社会インフラとして、さらには医療、科学用などあらゆるところでイメージセンサーが使われるようになった。

C C D 提像素子 (ICX008) ICX008はもとSONYの萩原良昭が設計開発し商品化に従事したchipである。 (画像提供:ソニー)

もとSONYの萩原良昭が真のOFD機能付きの Pinned Buried Photodiodeの発明者である。 See JPA1975-127646, JPA1975-127647 and JPA1975-134985

Λ1

SONY

Businesses & Products

About Sony Group

ology Employe

ustainability

Investor Relations

Contact Us Q

4

Japanese | English

Sony's Representative Inventions Supporting Stacked Multi-Functional CMOS Image Sensors

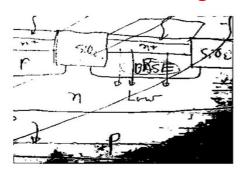
> Sony Corporation Sony Semiconductor Solutions Corporation

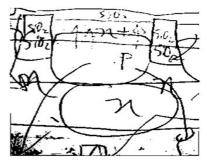
Pinned Photodiode Adopted for Back-Illuminated CMOS Image Sensors

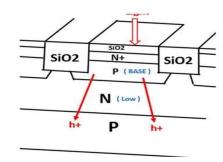
The history of Sony's inventions of image sensors goes back to the CCD era. Above all, Pinned Photodiode is a technology that contributes to improving the performance of back-illuminated CMOS image sensors, and the history of inventions and product development are as below.

In 1975, Sony invented a CCD image sensor that adopted a back-illuminated N+NP+N junction type and an N+NP+NP junction type Pinned Photodiode (PPD) (Japanese patent application number 1975-127646, 1975-127647 Yoshiaki Hagiwara). In the same year, inspired by such structure, Sony invented a PNP junction type PPD with VOD (vertical overflow drain) function (Japanese Patent No. 1215101 Yoshiaki Hagiwara). After that, Sony succeeded in making a principle prototype of a frame transfer CCD image sensor that adopted the PNP junction type PPD technology, having a high-impurity-concentration P+ channel stop region formed near a light receiving section by ion implantation technology for the first time in the world, and its technical paper was presented at the academic conference, SSDM 1978 (Y. Hagiwara, M. Abe, and C. Okada, "A 380H x 488V CCD imager with narrow channel transfer gates", Proc. The 10th Conference on Solid State Devices, Tokyo, (1978)). In 1980, Sony succeeded in making a camera integrated VTR which incorporated a one-chip frame transfer CCD image sensor that adopted the PNP junction type PPD. President Iwama in Tokyo, Chairperson Morita in New York, at the time held a press conference respectively on the same day, which surprised the world. In 1987, Sony succeeded in developing a 8 mm video camcorder that adopted, for the first time in the world, the interline transfer CCD image sensor, which incorporated "PPD having a high-impurity-concentration P+ channel stop region formed near the light receiving section by ion implantation technology" with VOD function, and became the pioneer of the video camera market. The PPD technology that has been nurtured through such a long history is still used in back-illuminated CMOS image sensors.

Hagiwara Note at Sony in March, 1975







The evidence that Hagiwara at Sony is the inventor of Hole Accumulation Diode (HAD) is given here. The evidence that Hagiwara at Sony is the inventor of Buried Photodiode (BPD) is also given here. The evidence that Hagiwara at Sony is the inventor of Pinned Photodiode (PPD) is also given here. See also Japanese Patent Applications JPA 1975-127646, JPA 1975-127647 and JPA 1975-134985